

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ФР) ЭЛЕКТРОНОВ В СУБМИКРОННЫХ СЛОЯХ В ГРЕЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н.

В зависимости от соотношений между характерными частотами релаксации энергии проведена классификация разновидностей разогрева носителей в полупроводниковых субмикронных слоях, поперечные размеры которых меньше длины релаксации энергии на объемных акустических фононах. В рамках квазиупругости рассеяния сформулированы модельные граничные условия для симметричной части функции распределения. Установлен критерий применимости приближения электронной температуры и получено для нее аналитическое выражение в предположении слабого разогрева.

Одной из основных тенденций развития современной микроэлектроники является переход к субмикронным размерам полупроводниковых образцов, используемых в приборах. Учитывая, что одна из принципиальных характерных длин полупроводникового материала — длина остыивания l [1, 2] (длина релаксации энергии) — лежит в интервале $1 \div 10$ мкм, мы переходим к условию $d \leq l$, где d — один из характерных размеров прибора. Если при этом (как это обычно имеет место) $d \gg l$ (l — импульсная длина свободного пробега), то возникает вопрос о виде симметричной части ФР носителей тока, которая при квазиупругом рассеянии электронов ($l \gg d$) определяется каналами релаксации энергии, получаемой от внешнего электрического поля E_0 .

Для определенности рассмотрим полупроводниковый образец в виде однородной по химическому составу пленки, безграничной в плоскости xy и имеющей конечную толщину d в направлении Oz , существенно меньшую длины остыивания l (субмикронный слой).

Релаксационные процессы предполагаются происходящими в объеме и на границе. Они состоят из взаимодействия невырожденных электронов между собой и с деформационными акустическими фононами (АФ), а также с поверхностным слоем рассеивателей, в котором релаксируют как импульс, так и энергия носителей [2-4].

Введем частоты релаксации импульса в объеме $\nu(\varepsilon)$ и на границе $\nu_r(\varepsilon) = v_r/d$ (v_r — тепловая скорость носителей). Соответствующий темп релаксации энергии будем характеризовать величинами $\tilde{\nu}(\varepsilon)$ и $\tilde{\nu}_r(\varepsilon)$, которые при квазиупругих механизмах рассеяния значительно меньше $\nu(\varepsilon)$ и $\nu_r(\varepsilon)$ ($\tilde{\nu}, \tilde{\nu}_r \gg \nu, \nu_r$).¹ В силу $d \gg l$ $\nu \gg \nu_r$. Что касается частоты межэлектронного взаимодействия $\nu_{ee}(\varepsilon)$, то (см. [2]) $\nu \gg \nu_{ee}$ (соотношение между ν_{ee} и $\tilde{\nu}$ может быть произвольным).

В связи с наличием нескольких каналов релаксации энергии ($\tilde{\nu}, \tilde{\nu}_r$) и ролью межэлектронных взаимодействий характер разогрева носителей в поле E_0 [вид симметричной части ФР $f_0(\varepsilon, \mathbf{r})$] будет существенно различным в зависимости от соотношений между частотами $\tilde{\nu}, \tilde{\nu}_r, \tilde{\nu}_{ee}$. Существующие возможности можно классифицировать следующим образом:

$$\text{I. } \nu_{ee} \gg \tilde{\nu}, \tilde{\nu}_r. \quad (1)$$

¹ Квазиупругость рассеяния ($\tilde{\nu} \ll \nu$) обеспечивает [5] малость анизотропной части ФР по сравнению с изотропной. Для того чтобы последнее соотношение не нарушилось поверхностью релаксации энергии и импульса, должно быть $\tilde{\nu}_r \ll \nu_r$.

Для соответствующих длин неравенствам (1) отвечают неравенства

$$l_{ee} \ll l, d, \quad (2)$$

где l_{ee} — длина $e-e$ -взаимодействия [3], $d = v_r / \sqrt{\nu_r} \gg d$ — введенная далее поверхностная длина остыивания.

Так как при выполнении (1), (2) электронная подсистема энергетически квазизолирована, в данной ситуации можно ввести электронную температуру T_e , даже если $d \ll l_{ee}$. В этом случае кинетическое уравнение Больцмана (КУБ) содержит интегралы межэлектронных (S_{ee}) и электрон-фононных (S_{ep}) столкновений ($S_{ee} \gg S_{ep}$ [2]), а ν_r формирует граничные условия (ГУ) для T_e .² Установившийся стационарный режим определяется соотношением между частотами ν и ν_r (l и d).

Заметим, что введенный в [6] критерий приближения электронной температуры, сводящийся к условию $l_{ee} \ll d$, требует уточнения: так как $d \ll l$ и возможно выполнение неравенства $d \ll l_{ee} \ll l$, его следует переопределить как $l_{ee} \ll d$.

$$\text{II. } \nu_r \gg \nu_{ee}, \nu (d \ll l_{ee}, l). \quad (3)$$

В данном случае электронная температура не успевает сформироваться, даже если $\nu_{ee} \gg \nu$, и вся получаемая от поля энергия выводится через боковые поверхности. Поэтому кинетика процесса определяется поперечным (по отношению к E_0) баллистическим пролетом. В КУБ можно пренебречь всеми интегралами столкновений электронов с рассеивающими центрами, а ν_r сформирует ГУ для парциальных потоков через стенку для анизотропной части ФР $f_1(\varepsilon, r)$. Заметим, что переход от ситуации I к ситуации II при достаточной концентрации электронов ($\nu_{ee} \gg \nu$) может быть осуществлен уменьшением толщины образца d .

$$\text{III. } \nu \gg \nu_r, \nu_{ee} (l \ll d, l_{ee}).$$

При данном соотношении частот $e-e$ -взаимодействия релаксация как энергии, так и импульса на границе несущественна. Однако при формальном совпадении в данном случае физической ситуации с безграничной средой в отсутствие межэлектронного взаимодействия наличие границ (и ГУ на них) приводит априори к присутствию в КУБ пространственных производных, что в свою очередь может привести к зависимости от координат и ФР.

$$\text{IV. } \nu \sim \nu_r \gg \nu_{ee}.$$

В этом случае потери энергии в объеме и на поверхности одинаково эффективны, и для нахождения $f_0(\varepsilon, r)$ и $f_1(\varepsilon, r)$ необходимо решать то же КУБ, что и в (3), но с ненулевыми ГУ.

$$\text{V. } \nu_{ee} \sim \nu_r \gg \nu,$$

$$\text{VI. } \nu_{ee} \sim \nu \gg \nu_r,$$

$$\text{VII. } \nu_{ee} \sim \nu \sim \nu_r.$$

В V—VII энергетические релаксационные процессы в объеме и на границе следует рассматривать совместно с $e-e$ -взаимодействием. Однако, ввиду того что ν_{ee} не является преобладающей частотой, необходимо решать КУБ с интегралом $e-e$ -столкновений, являющимся билинейным функционалом от ФР. Поэтому V—VII аналитически проанализировать не удается.

Из фигурирующих выше характерных частот выражения для ν , ν_r , ν_{ee} хорошо известны (см. [2, 7]). Что касается ν_r , то она определяется механизмами релаксации энергии на поверхности. Поэтому для заданного ν_r необходимо формировать ГУ для $f_0(\varepsilon, r)$.

Под границей, с точки зрения релаксации энергии, мы будем понимать слой толщиной $\delta \ll d$ нейтральных атомов, ионов, поверхностных фононов и дру-

² В силу $\nu_{ee} > \nu_r$ релаксация энергии на границах не может нарушить фермиевский вид симметричной части ФР.

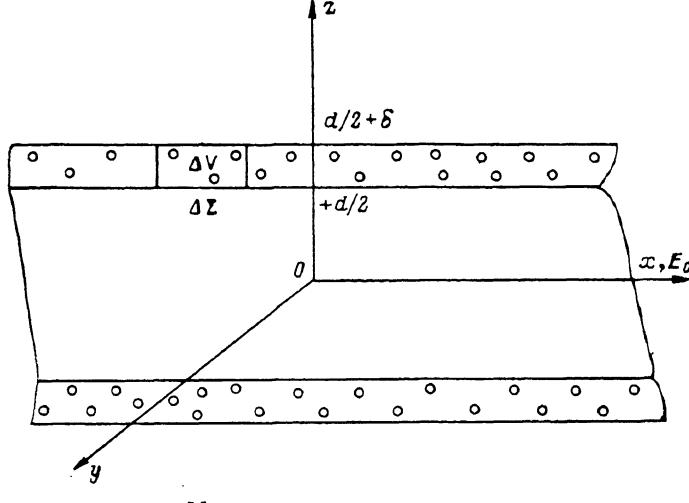
тих рассеивателей свободных носителей тока, находящихся как подсистема в состоянии термодинамического равновесия с температурой T (см. рисунок).

Существенным является тот факт, что в рамках квазиупругого рассеяния интеграл столкновений электронов с указанными рассеивателями формально имеет один и тот же вид [², ⁵], а именно

$$S_{ea}(f_0) = \frac{T}{g(\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left[\varepsilon g(\varepsilon) \tilde{v}_{ea}(\varepsilon) \left(\frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} + \frac{f_0}{T} \right) \right], \quad (4)$$

где $g(\varepsilon)$ — плотность электронных состояний, \tilde{v}_{ea} — частота релаксации энергии в слое, которая по существу и отличает релаксационные свойства одного механизма релаксации энергии на границе от другого.

В общем случае можно предположить, что $\tilde{v}_{ea}(\varepsilon) = \tilde{v}_{ea}^0 (\varepsilon/T)^q$, где q — некоторый параметр. Отметим, что данный подход не является микроскопическим расчетом поверхностных механизмов релаксации энергии, а ставит целью смо-



Модель приграничного слоя.

делировать структуру ГУ, основываясь на указанной квазиупругости. Поэтому в целом он носит феноменологический характер и для выбора механизма рассеяния не является принципиальным. В настоящей работе мы ограничимся рассеянием на нейтральных атомах. Для них $\tilde{v}_a(u) = \tilde{v}_a^0 u^{1/2}$, ($u = \varepsilon/T$) и (4) приобретает вид [²]

$$S_{ea}(f_0) = \tilde{v}_a^0 u^{-1/2} \frac{\partial}{\partial u} \left[u^2 \left(f_0 + \frac{\partial f_0}{\partial u} \right) \right], \quad (5)$$

где $\tilde{v}_a^0 = \sqrt{2\pi a^2 m^{1/2} N_a T^{1/2}} (2m/M)$, N_a — концентрация атомов, a — их «радиус», m , M — соответственно массы электрона и атома.

Запишем уравнение непрерывности для парциального тока $j(\varepsilon, z)$ в слое толщиной δ в следующем виде [³]:

$$\operatorname{div} j(\varepsilon, z) = g(\varepsilon) S_{ea}(f_0). \quad (6)$$

В (6) мы пренебрегли изменением $j(\varepsilon, z)$ в указанном слое за счет электрического поля.

Выделим объем $\Delta V = \delta \Delta \Sigma$ (рис. 2) и проинтегрируем по нему равенство (6). Пренебрегая потоками через боковые поверхности и полагая $j_z(\varepsilon, z)$, $S_{ea}(f_0)$ постоянными, равными своим значениям на границе $z = \pm d/2$, получим

$$j_z(\varepsilon, z) |_{z=\pm d/2} = g(\varepsilon) S_{ea}(f_0) |_{z=\pm d/2}. \quad (7)$$

Здесь

$$\mathbf{j}_z(\varepsilon, z) = -\frac{2}{3m} \varepsilon \frac{g(\varepsilon)}{\nu(\varepsilon)} \left[\frac{\partial f_0}{\partial z} + eE_1(z) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \right], \quad [3] \quad (8)$$

где $E_1(z)$ — поле, связанное с ограниченностью образца в направлении Oz , $g(\varepsilon) = g_0 \sqrt{\varepsilon}$ (изотропная, параболическая зона), $\nu(\varepsilon) = \nu_0 (\varepsilon/T)^{1/2}$ [2].

Поперечное электрическое поле $E_1(z)$ определим из условия разомкнутости образца в направлении Oz : $j_z(z)|_{z=\pm d/2} = 0$. Так как, по предположению, задача одномерная, из $\operatorname{div} j(z) = 0$ следует

$$j_z(z) = \int_0^\infty dz j_z(\varepsilon, z) = 0.$$

Переходя к безразмерным величинам $\varepsilon = z/d$, $\gamma_1 = eE_1 l/T$, получим

$$\gamma_1(\xi) = \alpha \frac{\partial}{\partial \xi} \int_0^\infty du u f_0(u, \xi) \int_0^\infty du f_0(u, \xi), \quad (9)$$

где $\alpha = l/d$.

Подставляя (8) и (9) в (7), запишем ГУ для симметричной части ФР $f_0(u, \xi)$ в следующем виде:

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} v_r u \left(\alpha \frac{\partial f_0}{\partial \xi} + \gamma_1 \frac{\partial f_0}{\partial u} \right) \Big|_{\xi=\pm 1/2} = \pm s_0 \frac{\partial}{\partial u} \left[u^2 \left(f_0 + \frac{\partial f_0}{\partial u} \right) \right] \Big|_{\xi=\pm 1/2}. \quad (10)$$

Здесь $s_0 = \lim_{\delta \rightarrow 0} (\delta \tilde{v}_a^0)$ имеет размерность скорости и по смыслу может быть названа поверхностной скоростью релаксации энергии. Из определения s_0 следует, что она отлична от нуля только при стремлении \tilde{v}_a^0 к ∞ при $\delta \rightarrow 0$.

Для того чтобы понять, чем определяется введенная выше частота \tilde{v}_r и как она связана с s , рассмотрим ГУ (10) в случае, когда f_0 — ФР Максвелла с электронной температурой T_e :

$$f_0(u, \xi) = N \left(\frac{T}{T_e} \right)^{s/2} \exp \left(-u \frac{T}{T_e} \right), \quad (11)$$

где $N = 2n/\sqrt{\pi} g_0 T^{3/2}$, n — равновесная концентрация носителей.

С этой целью введем парциальную плотность потока тепла $q_z(u, \xi)$ и интегральную $Q_z(\xi)$:

$$q_z(u, \xi) = \frac{T}{e} j_z(u, \xi) u, \quad (12)$$

$$Q_z(\xi) = \frac{T}{e} \int_0^\infty du u j_z(u, \xi). \quad (13)$$

Умножив (10) на $(T/e) u$ и проинтегрировав, получаем интегральные ГУ, сводящиеся к потоку тепла носителей в пограничном слое:

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} v_r \int_0^\infty du u^2 \left(\alpha \frac{\partial f_0}{\partial \xi} + \gamma_1 \frac{\partial f_0}{\partial u} \right) \Big|_{\xi=\pm 1/2} = \pm s_0 \int_0^\infty du u^2 \left(f_0 + \frac{\partial f_0}{\partial u} \right) \Big|_{\xi=\pm 1/2}. \quad (14)$$

Подставляя (11) в (9) и (14), получаем

$$\gamma_1(\xi) = \frac{\alpha}{2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{T_e}{T} \right), \quad (15)$$

$$\left(\frac{T}{T_e} \right) \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{T_e}{T} \right) \Big|_{\xi=\pm 1/2} = \pm 3 \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{s_0}{v_r} \left(1 - \frac{T}{T_e} \right) \Big|_{\xi=\pm 1/2}. \quad (16)$$

Фигурирующий в (16) параметр s связан с обычно используемым параметром η [8] соотношением $s_0 = 1/3 \sqrt{2/3} v_r d (\eta/x)$, где x — электронная теплопроводность.

Электронную температуру T_e определим из уравнения баланса энергии [8]

$$\frac{\partial Q_x}{\partial z} - j_x E_0 = P(T_e), \quad (17)$$

где j_x , $P(T_e)$ — соответственно плотность электрического тока в направлении E_0 и энергия, передаваемая электронам в единицу времени АФ [2].

Ограничимся слабыми электрическими полями ($\gamma_0 \ll 1$), где $\gamma_0 = eE_0 l/T$. В этом случае T_e можно разложить в ряд по γ_0^2 и, ограничиваясь членами первого порядка малости, записать

$$\frac{T_e}{T} = 1 + \varphi(\xi) \gamma_0^2, \quad (18)$$

где $\varphi(\xi)$ — неизвестная функция, подлежащая определению из (17).

Подставляя (18) в (16), получаем ГУ для $\varphi(\xi)$:

$$\frac{d\varphi(\xi)}{d\xi} \Big|_{\xi=\pm\gamma_0} = \mp \frac{s}{v_r} \varphi(\xi) \Big|_{\xi=\pm\gamma_0}. \quad (19)$$

Здесь $s = 3\sqrt{3/2}s_0$.

В указанном приближении уравнение баланса (17) сводится к следующему виду:

$$\frac{d^2\varphi(\xi)}{d\xi^2} - \lambda^2 \varphi(\xi) + \beta^2 = 0, \quad (20)$$

где

$$\lambda^2 = 3(d/l)^2, \quad \beta^2 = 1/2(d/l)^2. \quad (21)$$

Полагая ГУ симметричными и используя (19), получаем явный вид $\varphi(\xi)$:

$$\varphi(\xi) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{\operatorname{ch} \lambda \xi}{\lambda (v_r/s) \operatorname{sh}(\lambda/2) + \operatorname{ch}(\lambda/2)} \right). \quad (22)$$

Используя (21), можно записать

$$\lambda(v_r/s) = \sqrt{3}(d/l), \quad (23)$$

где $d = d(v_r/s)$.

Подставляя (22) в (18), получаем

$$T_e(\xi) = T \left[1 + \frac{1}{6} \left(1 - \frac{\operatorname{ch} \lambda \xi}{\sqrt{3}(d/l) \operatorname{sh}(\lambda/2) + \operatorname{ch}(\lambda/2)} \right) \gamma_0^2 \right]. \quad (24)$$

Обратим внимание на то, что выражение (11) с учетом (18) и (22) является решением задачи о виде ФР в условиях выполнения неравенств (1). При этом полученное выражение остается справедливым и при $d \ll l$. Единственным необходимым требованием здесь является выполнение (2).

Как видно из (24), разогрев электронного газа существенно зависит от соотношения длин d и l . Рассмотрим два предельных случая: $d \gg l$ и $d \ll l$.

Первое соотношение при фиксированных размерах образца может иметь место, например, при $s \rightarrow 0$, т. е. при квазиадиабатических (в пределе адиабатических) ГУ. Электроны рассеивают энергию на объемных АФ, и T_e принимает вид

$$T_e = T(1 + 1/\epsilon \gamma_0^2). \quad (25)$$

Выражение (25) в точности совпадает с электронной температурой в массивном полупроводнике или пленке как угодно малой толщины с зеркально отражающими внутренними поверхностями.

При обратном соотношении между длинами

$$T_e(\xi) = T \left[1 + \frac{1}{6} \left(1 - \frac{\operatorname{ch} \lambda \xi}{\operatorname{ch}(\lambda/2)} \right) \gamma_0^2 \right] \approx T \left[1 + \frac{1}{16} \left(\frac{d}{l} \right)^2 (1 - 4\gamma_0^2) \gamma_0^2 \right], \quad (26)$$

т. е. T_e существенно зависит от d (тепловой размерный эффект; см. [8]).

В данном случае электронная температура устанавливается в результате баланса вводимой в электронную систему энергии и ее теплоотвода через бо-

ковые поверхности. Величину d естественно назвать поверхностью длиной релаксации энергии или поверхностью длиной остывания. Из ее определения (23) видно, что каким бы ни был тонкий слой, но если $s \rightarrow 0$, то $\bar{d} \rightarrow \infty$. При $s \rightarrow v_r$ $\bar{d} \rightarrow d$.

Так как любой диффузионной длине может быть поставлена в соответствие релаксационная частота [3], величине \bar{d} будет отвечать поверхность энергетическая частота $\tilde{\nu}_r$, определяемая из соотношения $\bar{d} = v/\sqrt{\nu \tilde{\nu}_r}$. Отсюда и из (23) следует, что $\tilde{\nu}_r = \nu_r (s^2/v_r^2) (\nu_r/v)$. Так как $v \gg \nu_r$, то $\tilde{\nu}_r \ll \nu_r$ даже при $s \rightarrow v_r$.

Список литературы

- [1] Грибников З. С., Мельников В. И., Сорокина Т. С. // ФТТ. 1966. Т. 8. В. 11. С. 3379—3382.
- [2] Басс Ф. Г., Гуревич Ю. Г. Горячие электроны и сильные электронные волны в плазме полупроводников и газового разряда. М., 1975. 400 с.
- [3] Рашиба Э. И., Грибников З. С., Кравченко В. Я. // УФН. 1976. Т. 119. В. 1. С. 3—47.
- [4] Ваксер А. И., Гуревич Ю. Г. // УФЖ. 1979. Т. 24. В. 8. С. 1208—1212.
- [5] Гуревич А. В., Шварцбург А. Б. Нелинейная теория распространения радиоволны в ионосфере. М., 1973. 272 с.
- [6] Грибников З. С., Прима Н. А. // ФТП. 1971. Т. 5. В. 7. С. 1274—1280.
- [7] Гуревич Л. Э., Гасымов Т. М. // ФТТ. 1967. Т. 9. В. 1. С. 106—115.
- [8] Басс Ф. Г., Бочков В. С., Гуревич Ю. Г. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках. М., 1984. 288 с.

Тираспольский государственный
педагогический институт
им. Я. О. Галана

Получена 20.02.1990
Принята к печати 21.05.1990